

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
12. Mai 2005 (12.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/042156 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **B01J 37/16**,  
31/18, 31/30, C07F 15/04, C07C 253/10

(74) Gemeinsamer Vertreter: **BASF AKTIENGE-  
SELLSCHAFT**; 67056 Ludwigshafen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2004/012179**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
28. Oktober 2004 (28.10.2004)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:  
10351000.1 30. Oktober 2003 (30.10.2003) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): **BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]**;  
67056 Ludwigshafen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HADERLEIN, Gerd**  
[DE/DE]; Hochgewanne 93a, 67269 Grünstadt (DE).  
**BAUMANN, Robert** [DE/DE]; E 7, 23, 68159 Mannheim  
(DE). **BARTSCH, Michael** [DE/DE]; Konrad-Ade-  
nauer-Str. 38, 67433 Neustadt (DE). **JUNGKAMP,**  
**Tim** [DE/BE]; Magnoliaaan 19, B-2950 Kapellen (BE).  
**LUYKEN, Hermann** [DE/DE]; Brüsseler Ring 34, 67069  
Ludwigshafen (DE). **SCHEIDEL, Jens** [DE/DE]; Bütte-  
mer Weg 12, 69493 Hirschberg (DE). **SIEGEL, Wolfgang**  
[DE/DE]; Goethestr.34b, 67117 Limburgerhof (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): **AE, AG, AL,**  
**AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,**  
**CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,**  
**FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,**  
**KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,**  
**MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,**  
**PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,**  
**TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,**  
**ZW.**

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): **ARIPO (BW,**  
**GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,**  
**ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,**  
**TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,**  
**EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,**  
**RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,**  
**GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).**

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-  
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-  
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der  
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: **METHOD FOR PRODUCING OF NICKEL(0)/PHOSPHORUS LIGAND COMPLEXES**

(54) Bezeichnung: **VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON NICKEL(0)-PHOSPHORLIGAND-KOMPLEXEN**

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing nickel(0)/phosphorus ligand complexes, which comprise at least one nickel(0) central atom and at least one phosphorus-containing ligand. Said method is characterised in that a nickel(II) source, containing nickel bromide, nickel iodide or mixtures thereof, is reduced in the presence of at least one phosphorus-containing ligand.

(57) Zusammenfassung: Zusammenfassung Beschrieben wird ein Verfahren zur Herstellung von Nickel(0)-Phosphorligand-Komplexen enthaltend mindestens ein Nickel(0)-Zentralatom und mindestens einen phosphorhaltigen Liganden. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Nickel(II)-Quelle, die Nickelbromid, Nickelioidid oder Mischungen davon enthält, in Gegenwart mindestens eines phosphorhaltigen Liganden reduziert wird.



**WO 2005/042156 A1**